

# Q単位シロキサン化合物の製造技術、 分析評価技術講座 **ワークショップ**

日時

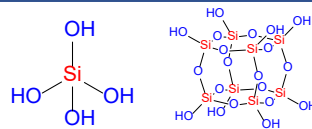
**2026年3月6日(金)**



13時30分～17時50分 (受付時間 13時00分～13時30分)

対象者

企業の研究者・開発者、大学教員・学生



内容  
(予定)

13:00-13:30 受付

13:30-13:40 開会挨拶・趣旨説明

13:40-14:25 シロキサン化合物の基礎およびポリシロキサンの合成  
(東京理科大学 山本一樹 講師)

14:25-15:10 Q単位シラノールの単離と水素結合性無機構造体(HIF)の開発  
(産総研 五十嵐正安 上級主任研究員)

15:10-15:20 —休憩 & 名刺交換—

15:20-16:05 アルコキシシランの加水分解反応を対象とした  
反応中化学種の追跡手法の確立  
(日本ウォーターズ 山田光一郎 シニアアプリケーションケミスト)

16:05-16:50 直鎖状ポリシロキサンのイオン化および高密度集積  
(香川大学 原光生 准教授)

16:50-17:00 —休憩 & 名刺交換—

17:00-17:45 防曇材料、断熱材料としてのポリシルセスキオキサンの設計と合成  
(広島大学 大下浄治 教授)

17:45-17:50 質疑応答・閉会

17:50-18:10 —移動—

18:10-20:00 懇親会 & 名刺交換会 (産総研内食堂)

お申込み

<https://forms.office.com/r/kU2Wxj6vW6>

※只今申込を受け付けています。申込締切:2026年2月27日(金)



会場

産業技術総合研究所 つくば中央事業所 第5群5-2棟 6603室  
〒305-8565 茨城県つくば市東1-1-1

お問い合わせ

産業技術総合研究所 触媒化学研究部門 五十嵐正安

Tel: 050-3521-2115

E-mail : M-silicone-kouza-ml@aist.go.jp